شرکت (دانش بنیان تولیدی)
توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

Lithography
Step & Repeat
A-SR100

دستگاه تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک‌سازی یکی از دستگاه‌هایی است که در فرایند لیتوگرافی بکار می رود. علاوه بر این کاربرد مهم دیگر این دستگاه تولید ماسک با دقت ۴ میکرون است که امکان ساخت سنسورهای با تکنولوژی بالا را فراهم می سازد. این دستگاه قابلیت الگودهی چندین طرح در یک RUN اجرا را دارد.

- **تنظیم با دو ضریب کوچک سازی ۵ و ۱۰**
- **مجهز به سامانه نگهدارنده ماسک و نمونه**
- **ایجاد الگوها با دقت چند میکرون روی بسترهای تخت**
- **مجهز به سیستم اپتیکی به همراه منبع نور کاملا موازی**
- **انجام فرایند لیتوگرافی یک به یک با فوتورزیست های مثبت و منفی با لنز متفاوت**
- **ایجاد ماسک اپتیکی برای دستگاه ماسک الاینر و دستگاه لیتوگرافی رومیزی**
- **قابلیت تنظیم ارتفاع**
- **ساده بودن فرایند**

Technical data: *Reduction System*		
Sample size (inch)		0.5-4
Repeat Area		4inch
XY resolution		4 micron
Max. of spot for pattern		For 10X lens: 6mm For 5X lens: 12mm
Mask size (inch)		Up to 4
Exposure System	**wavelength**	365–400nm
	power	UV-20
	Beam size	4 inch
Minimum Feature size		4μm
	Z	±15mm
Maximum Mask size (mm×mm)		80*80
Working distances		9-20 mm
Sample loading mechanism		Manual
Anti-vibration platform		Damping base
PC		Software